

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】平成 19 年 5 月 31 日 (2007.5.31)

【公開番号】特開 2007-61735 (P2007-61735A)

【公開日】平成 19 年 3 月 15 日 (2007.3.15)

【年通号数】公開・登録公報 2007-010

【出願番号】特願 2005-250811 (P2005-250811)

【国際特許分類】

B 0 1 J 19/00 (2006.01)

【F I】

B 0 1 J 19/00 3 2 1

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 4 月 9 日 (2007.4.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ユニット化された複数の反応管内に反応に供する流体をセグメント状態として流通させて反応を行うことを特徴とする反応装置。

【請求項 2】

前記反応装置は、

反応管の数よりも少ないセグメント生成手段を用いて各反応管内でセグメント状態として流通させて反応を行うことを特徴とする請求項 1 に記載の反応装置。

【請求項 3】

複数の原料を混合して反応液を生成する混合部と、

前記反応液を流通させながら反応させるユニット化された複数の反応管と、

前記複数の反応管を流通する反応液を分割する分割剤を供給する分割剤供給源と、

当該分割剤供給源から前記複数の反応管に分割剤を間欠的に導入する分割剤導入機構とを備えることを特徴とする請求項 2 に記載の反応装置。

【請求項 4】

前記分割剤導入機構は、

複数の反応管に対して分配されるべき反応液を貯留するバッファ空間槽と、

該バッファ空間槽に連通し、前記複数の反応管に対応して形成された分配孔を有した分岐チャンバーを含んでいることを特徴とする請求項 3 に記載の反応装置。

【請求項 5】

前記分割剤導入機構が 1 回に導入する分割剤の体積は、

前記バッファ空間槽の容積以上に設定されていることを特徴とする請求項 4 に記載の反応装置。